

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成29年4月20日(2017.4.20)

【公表番号】特表2016-514165(P2016-514165A)

【公表日】平成28年5月19日(2016.5.19)

【年通号数】公開・登録公報2016-030

【出願番号】特願2016-503188(P2016-503188)

【国際特許分類】

C 07 J	43/00	(2006.01)
A 61 K	31/58	(2006.01)
A 61 P	35/00	(2006.01)
A 61 K	45/00	(2006.01)
A 61 P	43/00	(2006.01)
A 61 P	13/08	(2006.01)
A 61 P	15/00	(2006.01)
A 61 P	13/00	(2006.01)

【F I】

C 07 J	43/00	C S P
A 61 K	31/58	
A 61 P	35/00	
A 61 K	45/00	
A 61 P	43/00	1 2 1
A 61 P	13/08	
A 61 P	15/00	
A 61 P	13/00	
A 61 P	43/00	1 1 1

【手続補正書】

【提出日】平成29年3月14日(2017.3.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

細胞内のアンドロゲン受容体(AR)活性を阻害する方法であって：

細胞内のアンドロゲン受容体(AR)レベルを下方制御する工程；

を含む、方法。

【請求項2】

ARレベルを下方制御するステロイド系化合物を細胞に送達する組成物を投与する工程
を含む、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記化合物が、酢酸アピラテロン、TAK-700又はガレテロンから選択される参照
化合物よりも強力なアンドロゲン合成阻害剤ではない、請求項2に記載の方法。

【請求項4】

前記化合物が、酢酸アピラテロン、TAK-700又はガレテロンから選択される参照
化合物よりも強力なARアンタゴニストではない、請求項2に記載の方法。

【請求項5】

前記化合物が、A R を有する細胞の当該化合物への暴露が、A R の下方制御、A R が介在する転写の阻害、及び細胞増殖の阻害をもたらす、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 6】

前記 A R の下方制御及び A R が介在する転写の阻害が、細胞増殖の阻害の前に起こる、請求項 5 に記載の方法。

【請求項 7】

前記化合物が、1 μM を下回る I C 5 0 で C Y P 1 7 を阻害する能力を有することを特徴とする、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 8】

前記化合物が、約 1 5 μM を下回る G I 5 0 で C W R 2 2 R v 1 の増殖を阻害する能力を有することを特徴とする、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 9】

前記細胞が、全長及びスプライスバリアントの両方のアンドロゲン受容体を有する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 10】

前記スプライスバリアントアンドロゲン受容体がリガンド結合ドメインを欠く、請求項 9 に記載の方法。

【請求項 11】

前記スプライスバリアントアンドロゲン受容体が A R - V 7 である、請求項 9 に記載の方法。

【請求項 12】

前記細胞が A R 抗アンドロゲン又はアンドロゲン遮断療法に応答しない、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 13】

前記細胞が酢酸アビラテロンに耐性である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 14】

前記細胞がエンザルタミドに耐性である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 15】

前記細胞がアンドロゲン関連性疾患細胞である、請求項 1 に記載の方法。